

# **PCT**

## 世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 (11) 国際公開番号 WO00/53365 B23K 26/06 (43) 国際公開日 2000年9月14日(14.09.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/01089

(81) 指定国

添付公開書類

CN, DE, JP, US

(22) 国際出願日

1999年3月5日(05.03.99)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 三菱電機株式会社

(MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA)[JP/JP]

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

大川竜生(OKAWA, Tatsuki)[JP/JP]

祝 靖彦(IWAI, Yasuhiko)[JP/JP]

黒澤満樹(KUROSAWA, Miki)[JP/JP]

水野正紀(MIZUNO, Masanori)[JP/JP]

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

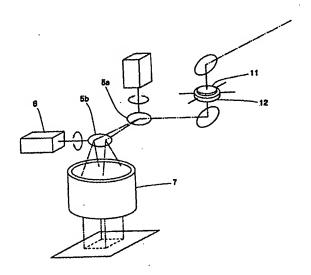
弁理士 宮田金雄, 外(MIYATA, Kaneo et al.) 〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内 Tokyo, (JP)

国際調査報告書

(54)Title: LASER MACHINING APPARATUS

(54)発明の名称 レーザ加工装置



A laser machining apparatus comprising a laser oscillator (3), an optical path system having galvanometer mirrors (5a, 5b) forming an optical path for directing the laser beam (2) outputted from the laser oscillator to a work (1) and an f0 lens (7), and a diffraction optical component (11) provided in the optical path between the laser oscillator and the galvanometer mirrors.

# (57)要約

この発明によるレーザ加工装置は、レーザ光を発生させるレーザ発振器(3)と、このレーザ発振器より出力された前記レーザ光(2)を被加工物(1)に導く光路を形成するガルバノミラー(5 a, 5 b)とf θ レンズ(7)とを有する光路系と、前記レーザ発振器と前記ガルバノミラーとの間の光路中に設けられた回折型光学部品(11)とを備えたものである。

#### 明 細 書

#### レーザ加工装置

### 5 技術分野

この発明は、レーザ加工装置、特に高速微細穴加工等に用いられるレーザ加工装置に関するものである。

#### 背景技術

・ 従来の一般的な微細穴加工用レーザ加工装置を第11図に示す。第1 10 1図に示したものは、例えば水平に XY テーブル14上に置かれた被加 工物1にパルス状レーザ光2を照射し任意のパターンに微細穴加工する ことを目的とした装置であり、パルス状レーザ光2を発生するレーザ発 振器3、レーザ光2を反射させて光路中を導く数枚のベンドミラー4、 レーザ光2を制御装置10の指令により任意の角度に反射させるガルバ 15 ノミラー5(この図では、2個のガルバノミラー5a,5b)、ガルバ ノミラー5を駆動するガルバノスキャナ6、ガルバノミラー5により与 えられるレーザ光2の角度を光路軸方向に対し平行に修正しレーザ光2 が被加工物 1 に垂直に照射するようにする f  $\theta$  レンズ 7 、加工結果の表 示に使用する CCD カメラ 8、ガルバノスキャナ 6,  $f \theta$  レンズ 7, 及び 20 CCD カメラ8を載せて被加工物1との距離を調整するために Z 方向に 移動するZ軸テーブル9、これらの駆動系の制御を行なう制御装置10 からなっている。このレーザ加工装置によれば、被加工物1上に垂直に レーザ光2を高速に位置決めするガルバノスキャナ6, ガルバノミラー 5. f θ レンズ 7 と、ごく短時間ビームを発振可能なパルスレーザ発振 25 器3との組合せにより、500 穴/秒という板金用レーザ加工に比べては

10

15

20

25

るかに高速な加工を可能としている。

上記のような加工装置を用いた微細穴加工について説明する。制御装置 10 上で設定された周波数と出力値に従ってレーザ発振器 3 から出力されるパルス状のレーザ光 2 が、数枚のペンドミラー4によりガルバノスキャナ 6 に取付けられたガルバノミラー5 a 、5 りまで導かれ、ガルバノスキャナ 6 により任意の角度に保持されたガルバノミラー5 a 、5 りに反射して f  $\theta$  レンズ 7 へ入射する。f  $\theta$  レンズ 7 に入射したレーザ光 2 は被加工物 1 上で焦点を結ぶ。また f  $\theta$  レンズ 7 に入射する直前のレーザ光 2 は様々な入射角をもっているが、f  $\theta$  レンズ 9 により被加工物 1 に垂直に照射されるように修正される。

レーザ発振器 3 から出力されるレーザ光 2 の発振のタイミングとガルバノミラー 5 a , 5 b の角度とを制御装置 1 0 で制御することにより、制御装置 1 0 にあらかじめ入力されている形状を加工することが出来る。このとき 1 パルスのレーザ光照射で一つの穴が加工されるが、被加工物 1 の材質に対して出力が十分でない等の場合には数パルスを一個所に繰り返して照射し深い穴を開ける等の方法が取られたりする。ガルバノミラー 5 a , 5 b によりレーザ光 2 をスキャン出来る範囲は限られている為、一定の形状の加工が終了すると XY テーブル 1 4 により被加工物 1 を次のスキャンエリアに移動し、再びガルバノスキャナ 6 を駆動し加工を行なう。上記のようにして任意の箇所に高速にレーザ光 2 を導き微細穴加工を行なう。

上記の手順によれば、加工装置一台の単位時間当たりの生産量を増やすにはガルバノスキャナの駆動速度をより高速にすること、パルスレーザ発振器の発振周波数をより高くかつ高出力のレーザ光を発振すること、XY テーブルの移動速度を高速化すること、の3つの方法により今以上に高速な加工が可能になる。

15

20

昨今の微細穴加工市場の急激な成長にともない、要求される加工速度が短期間のうちに数倍乃至数十倍に増大している。このためより高速に駆動できるガルバノスキャナ、より短時間で高出力のレーザ光をパルス状に発生するレーザ発振器の開発が期待されており、短期間で飛躍的に加工速度を向上させる技術を開発し製品化することが急務となっている。しかし、市場から要求されている5倍、10倍、更にそれ以上の加工時間の短縮を実現することはレーザ加工装置の位置決め速度を向上させる方法ではガルバノスキャナ、XYテーブルの能力が限界に近づきつつある現状から考えると非常に困難である。

10 また1台の発振器に複数の加工ヘッドを用意し、発振器から出てくる レーザ光を半透過ミラーを使い数段階に分けて分光する方法では、巨大 な光路系設計が必要であったり、光路調整が複雑になったりするなどの 問題点が有る。

一方、回折型光学部品(Diffractive Optical Element、以下適宜 DOE と記す)は、その表面に施された回折格子により入射する光を設計された分光数及びパターンに分光することが出来る光学部品であり、通常は一度のレーザ光発振で1個所の加工しかできないものが、例えば3分光するように設計された DOE を前述の微細穴加工用レーザ加工装置の光路系に挿入すれば、一度のレーザ光発振で同時に3個所の加工が可能となる。DOE はホログラフィック光学素子(HOE)とも呼ばれている。

この DOE を利用すると、所望の分光数と分光パターンをもった DOE を設計し、従来の光学系に使用して比較的簡単に加工速度を上げることが可能であり、上述の加工速度を向上させるといった課題の解決に繋がる。

25 ところが、DOE を光路系に挿入する場合、その挿入場所によっては設 計通りの仕様が発揮されにくくなることがある。たとえば、像転写光学

10

15

20

25

系を使用する場合は、レーザ光のパワーを効率良く使う為にマスクを使用するが、マスクの前に DOE を挿入してしまうと分光パターンにマスクの影響が出てしまう。例えば、ガルバノミラーの直後、f のレンズの直前に DOE を挿入した場合はレーザ光が DOE に斜めに入射することになり屈折率の変化により分光パターンに影響を与えることになるので、入射角度、及び入射領域を考慮した複雑な DOE の設計や複雑なガルバノスキャナ制御が必要である。例えば f のレンズの直後に DOE を挿入した場合は、ガルバノミラーのスキャンエリアを充分カバーする大きさのDOE が必要となり膨大な製作コストがかかるうえに、加工時に発生する粉塵、スパッタ等から DOE 表面を保護する手段が必要となり、さらにコストがかかってしまう。

また、ガルバノミラー、f のレンズを通ったレーザ光はX、Y方向それぞれのガルバノミラーと f のレンズの距離の差により指令値と加工位置とがずれてしまう。これを修正するためにプログラムによる位置の補正が必要となっている。またガルバノミラーは周囲温度等により微妙に反射角度が変化するため、空調室等で加工装置を使用することが望ましいが、夜間空調を切っていたり、空調の無い場所で使用したりする場合はこまめに補正値の修正を行なうことが必要である。これらの補正、補正値の修正を行なう方法として CCD カメラを利用した自動補正がある。補正プログラムにあらかじめ記入されたパターンにしたがってレーザ光で空けられた穴の座標値を CCD カメラで認識し、指令値と CCD カメラで測定した穴の座標値を CCD カメラで認識し、ずれ量をスキャンエリア内の穴の位置に従って補正量を計算し、スキャンエリア内全てにわたって補正するという方法が取られる。しかしながら CCD カメラで認識させるには CCD パターン毎にプログラムの修正を行なう必要があ

15

20

り、加工装置毎にプログラムを修正する手間がかるという問題が発生する。

また、DOE をその光路中に備えた加工装置においては DOE を通過したレーザ光は DOE の製作精度によりその強度がある程度ばらついて分岐される。出来る限りバラツキが小さいことが望ましいが、実際は DOE 製作手順上の問題や低次回折光の影響によるばらつきを全く無くすことは不可能である。そのため DOE を利用して加工を行なうと、分光強度のばらつきに比例して加工穴径がばらつくという結果が得られる。

このまま同一位置で数回または長時間連続でレーザ光を照射したとしても、穴径はエネルギーの強さに比例する為、加工穴径を均一に戻すことは出来ない。

また、DOE を通過したレーザ光は、必要なパターン以外に高次回折光がノイズとしても同時に分岐される。ノイズは DOE の製造過程や被加工物ごとに設定される加工条件の調整等によりある程度減少させることは可能であるが、全く無くすことは不可能である。分光数が少ない場合はノイズの分光強度は必要とされるパターンの分光強度に比べて小さく加工時も問題にならないことが多いが、分光数が増えてそれぞれの分光強度設計値が小さくなったり、DOE 製作上の問題によってパターンとノイズの分光強度が近い数値となる場合には、必要なパターン以外の場所に不必要な穴が加工されてしまうという問題が起きる。

この発明は、上述の課題を解決し、高速微細穴加工等の際に、従来の レーザ加工装置よりも高速で且つ正確な加工が可能なレーザ加工装置を 提供することを目的としている。

#### 25 発明の開示

この発明は、レーザ光を発生させるレーザ発振器と、このレーザ発振

25

器より出力された前記レーザ光を被加工物に導く光路を形成するガルバノミラーと f θ レンズとを有する光路系と、前記レーザ発振器と前記ガルバノミラーとの間の光路中に設けられた回折型光学部品とを備えたレーザ加工装置を提供するものである。

5 したがって、簡単な構成で、回折型光学部品による高速且つ正確な同時複数点加工ができるレーザ加工装置を得ることが出来る。

また、この発明は、回折型光学部品を前記光路中の定められた位置に 着脱する着脱手段を備えたレーザ加工装置を提供するものである。

したがって、ガルバノミラー等の補正時に、光路から回折型光学部品 10 を取り外した状態で補正を容易に行なうことが可能となり、また、複数 種の回折型光学部品を交換して使い分けることができ、複数種の加工パ ターンに容易に対応することができる。

また、この発明は、光路中に設けられた回折型光学部品の姿勢を調整する調整手段を備えたレーザ加工装置を提供するものである。

15 したがって、レーザ光が垂直に入射するように回折型光学部品の姿勢 を調整することが可能となり、適切な回折角を得ることができる。

また、この発明は、回折型光学部品により分岐され f  $\theta$  レンズにより 集光されたレーザ光の焦点位置でのビーム径を、光路中のレーザ発振器 と回折型光学部品の間に設けた像転写光学系の調整により操作するレー ザ加工装置を提供するものである。

したがって、回折型光学部品を備えたレーザ加工装置において、焦点位置での分光されたそれぞれのレーザ光の集光径を像転写光学系に設置されたマスク径によって一律に調整することが可能となり、被加工物の材質及び必要とする加工穴径に応じた加工結果を容易に得ることが出来る。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の一実施形態によるレーザ加工機の構成の概略図である。

第 2 図は、第 1 図に示した DOE 及び f $\theta$ レンズ周辺の要部拡大図である。

第3図は、一般的な加工方法を説明する図である。

第4図は、この発明の一実施形態による加工方法を示す図である。

第5図は、この発明の一実施形態による DOE の設置位置を説明する 概略図である。

10 第6図は、DOEの設置位置の比較例を説明する概略図である。

第7図は、DOEの設置位置の別の比較例を説明する概略図である。

第8図は、この発明の一実施形態による DOE 着脱保持装置の構成の概略図である。

第9図は、この発明の一実施形態による DOE 姿勢調整装置の構成の 概略図である。

第10図は、この発明の一実施形態による光路構成の概略図である。 第11図は、従来の一般的な微細穴加工用レーザ加工装置の構成の概 略図である。

20 発明を実施するための最良の形態

実施の形態1.

15

25

第1図はこの発明の第1の実施の形態によるレーザ加工装置を示すものである。第1図において、レーザ発振器3により発生したレーザ光2は発振器3に設けられたシャッタ13より放出される。レーザ光2は光路中に設けられた数枚のベンドミラー4により、保持装置12に保持されたDOE11へ導かれる。DOE11が備える回折格子によりレーザ光

15

20

25

2は一定のパターンに分岐される。分岐されたレーザ光 2 はベンドミラー4によりガルバノスキャナ 6 に保持されたガルバノミラー 5 a , 5 b へと導かれる。ガルバノスキャナ 6 により任意の角度にスキャンニングされるガルバノミラー 5 a , 5 b によって反射されたレーザ光 2 は任意の入射角をもって f  $\theta$  レンズ 7 に入射する。f  $\theta$  レンズ 7 に入射したレーザ光 2 は、被加工物 1 に垂直に入射するように補正されて出てくるとともに f  $\theta$  レンズ 7 が持つ焦点距離にしたがって集光されている。これらの構成により焦点位置におかれた被加工物 1 上に任意のパターンを加工することが可能となる。

10 第 2 図はこの実施の形態に使用される光路系の要部拡大図である。図中、11は DOE であり、ガルバノミラー 5 a より発振器側に挿入されている。DOE 11によって分岐されたレーザ光はガルバノミラー 5 a 5 b f  $\theta$  レンズ 7 を経て被加工物に集光される。

このとき通常は第3図に示すように、ある1点で加工した後パターン24分移動して次の加工を行なうが、第4図に示すようにあえて1穴分だけずらして移動し一度加工した箇所にパターン24の一部を重ねて加工を行なう。その次はパターン24分移動し、繰り返し一部重ね加工を行なう。このような加工方法を取ると、1回のビーム照射では分光強度の不均一性による不均一な穴径の加工結果がバラツキが発生してしまうが、1穴分移動して部分的に重ねてビーム照射することで穴径の不均一性を低くすることが出来る。

第 5 図、第 6 図、第 7 図は DOE の光路系内の設置位置を説明するための概略図である。光路中における DOE の挿入位置は様々であるが、第 5 図に示すように、光路中、ガルバノミラー 5 a の前に DOE 11を置くことが望ましい。例えば第 6 図のようにガルバノミラー 5 b 6 レンズ 7 との間に DOE 11を挿入した場合、ガルバノミラー 5 b 6 に反

15

20

射されたレーザ光が角度をもって DOE 11に入射することとなり、DOE 11は垂直にレーザ光が入射するように設計されているため斜めに入射すると屈折率が変化して所定の分光形状、分光強度が得られなくなる。入射角度等を考慮した DOE 11の設計は非常に高度な計算が必要であり、現状では極めて困難である。

10 DOE 1 1 への熱影響を与えやすくなっており、冷却装置等の熱影響を小っさくする機能が必要になる。

実施の形態 2.

第8図は、第1の実施の形態に示す光路系において DOE を容易に挿入、交換することができる着脱保持装置である。第8図の着脱保持装置は、ストック部15に保管してある DOE 11を交換アーム16により自動的に交換できる機構を備えている。また、光路調整や、ガルバノミラーのアライメント時にDOEを使用しない場合には光路からDOEを抜いた状態にして加工することが出来る。或いは、例えば作業者が必要に応じて手動でDOEを交換出来るような着脱機構を設けたものでも良い。

DOE はそれ自身の形状が可変にはならない為、ある一定のパターンに分光する回折格子を施した DOE を数種類用意しておき、それぞれを交換することにより任意のパターンの加工に、より木目細かく対応することが可能となる。

また、ガルバノミラー自動補正を行なう場合は、CCD カメラが加工結 25 果を認識しやすくする為、また DOE パターン毎にプログラムを修正す る必要を無くす為、また DOE の取付け姿勢等によりレーザ光が光軸中

10

15

25

心に回転して照射され加工結果が XY テーブル座標軸に対して傾き、CCD カメラによる認識及びプログラム修正が X 座標補正、Y 座標補正の他に回転軸補正を行う必要があり、装置及び制御が複雑になることを避ける為、CCD カメラの視野内には加工穴は 1 点であることが望ましく、そのため分岐されていないレーザ光が必要であり、補正時は DOE を光路中から取り外し可能であることが望ましい。 実施の形態 3.

第9図は、第1の実施の形態に示す光路系における DOE の姿勢を容易に調整することができる姿勢調整装置を示したものである。焦点位置における分光パターンの精度はDOE 製作の精度に大きく左右されるが、DOE と焦点位置間の距離も影響を与えるためレンズの持つ焦点距離の誤差を調整する等のために、姿勢調整用保持装置 17は光軸 18に対して上下方向に調整出来る機構を装備する。また、ガルバノミラーを介し被加工物にレーザ光が照査されるが、ガルバノミラーの取付け角度により加工テーブル上のXY座標に対し分光パターンが傾く。このため姿勢調整用保持装置 17は DOE 11 を光軸 18中心に回転させる機構を持つ。また、レーザ光は DOE 11に対し垂直に入射することが最適な回折角を得る為には望ましい。そのため姿勢調整用保持装置 17は光軸 18に対して垂直になるように調整できる機構を装備する。

20 実施の形態4.

第10図は、第1の実施の形態に示す光路系においてマスク調整機構を装備した像転写光学系25を光路中の DOE 11の前に採用した光路系である。この像転写光学系25によればマスク19の口径20を調節することでマスク19と f  $\theta$  レンズ 7 との距離22と f  $\theta$  レンズ 7 の焦点距離23との比により焦点位置におけるビーム径21の大きさを調整し、マスク19により決定されたサイズのビーム径を被加工物1に転写

出来る。この実施の形態は、DOE 1 1 によって分光されたレーザ光の焦点位置でのそれぞれのビーム径を任意の大きさに調整する機能を持つ光路系の一例である。

ところで上記の説明では、この発明をレーザ加工装置を微細穴加工に 利用する場合について述べたが、その他のレーザ加工についても利用で きることは言うまでもない。

# 産業上の利用可能性

以上のように、この発明にかかるレーザ加工装置は、例えば微細穴加 10 工など、高い加工精度を要求される工業用レーザ加工装置として用いら れるのに適している。

15

20

#### 請求の範囲

- 1. レーザ光を発生させるレーザ発振器と、このレーザ発振器より出力された前記レーザ光を被加工物に導く光路を形成するガルバノミラーと f θ レンズとを有する光路系と、前記レーザ発振器と前記ガルバノミラーとの間の光路中に設けられた回折型光学部品とを備えたことを特徴とするレーザ加工装置。
- 2. 回折型光学部品を前記光路中の定められた位置に着脱する着脱手段 を備えたことを特徴とする請求項第1項記載のレーザ加工装置。
  - 3. 光路中に設けられた回折型光学部品の姿勢を調整する調整手段を備えたことを特徴とする請求項第1項記載のレーザ加工装置。

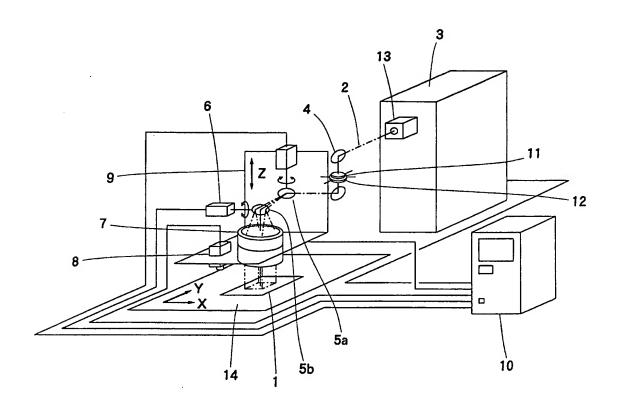
15

5

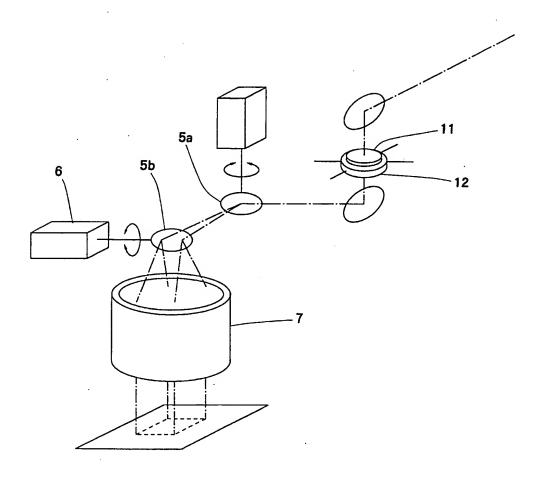
4. 回折型光学部品により分岐され f θ レンズにより集光されたレーザ 光の焦点位置でのビーム径を、光路中のレーザ発振器と回折型光学部品 の間に設けた像転写光学系の調整により操作することを特徴とする請求 項第1項記載のレーザ加工装置。

20

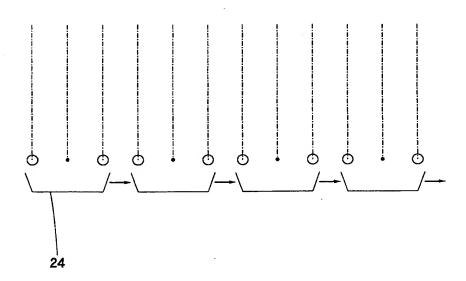
第1図



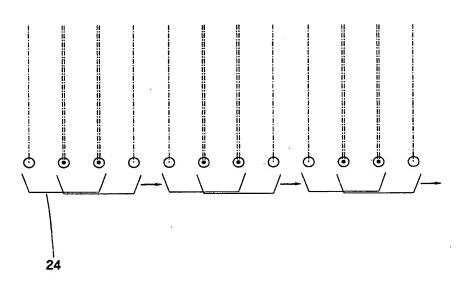
第2図



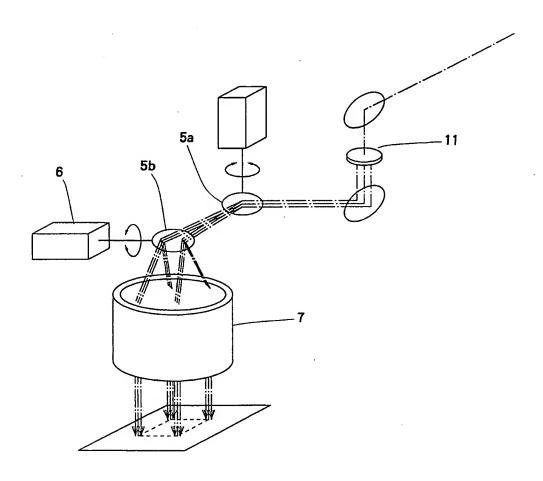
第3図



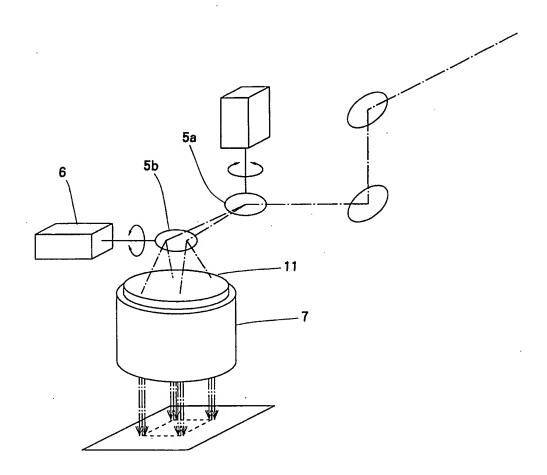
第4図



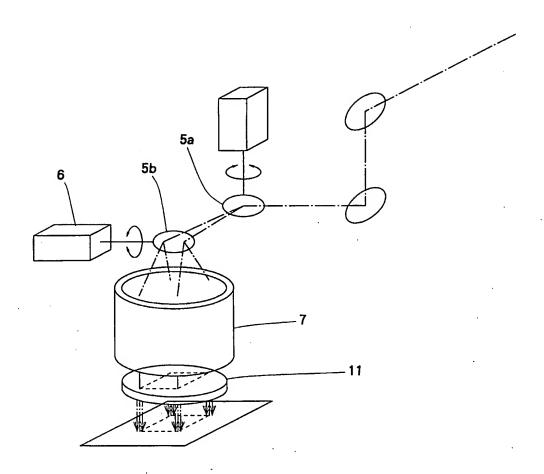
第5図



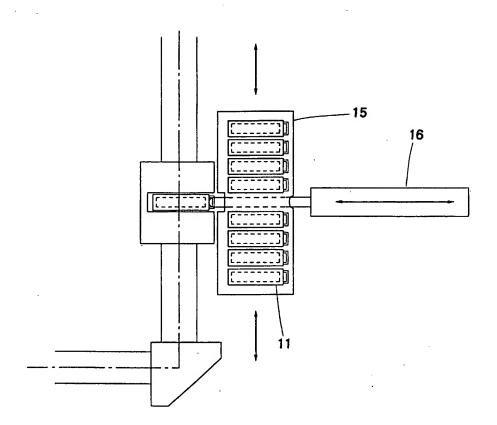
第6図



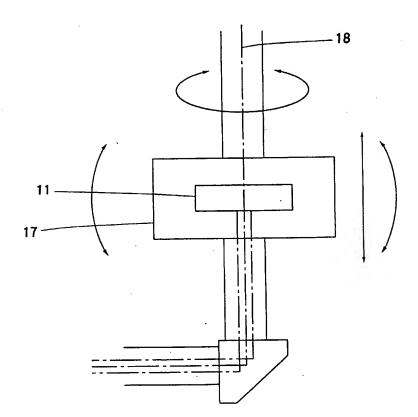
第7図



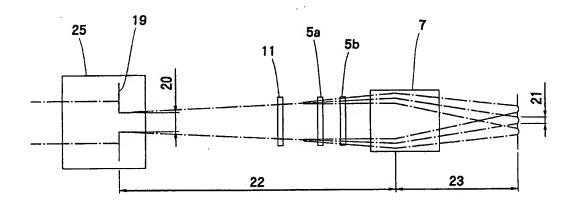
第8図



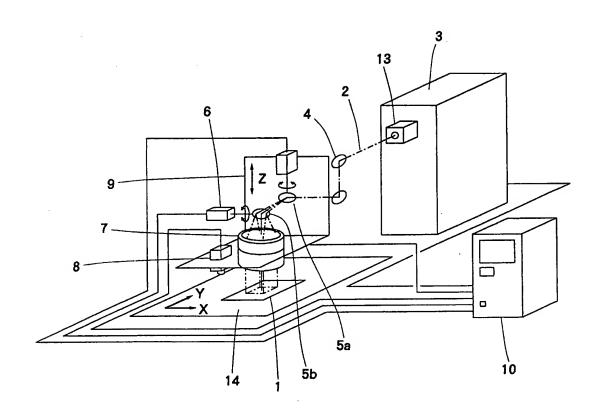
第9図



第10図



第11図



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/01089

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>6</sup> B23K26/06			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system followed	by classification symbols)		
Int.Cl <sup>6</sup> B23K26/00-26/06			
Documentation searched other than minimum documentation to the			
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1999 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999			
Electronic data base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, se	earch terms used)	
• •			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Relevant to claim No.	
Y JP, 10-200269, A (Ibiden Co 31 July, 1998 (31. 07. 98)		1-4	
Y JP, 4-22190, U (Nippon Denki K.K.),	JP, 4-22190, U (Nippon Denki Laser Kiki Engineering K.K.),		
	24 February, 1992 (24. 02. 92), (Claims ; Fig. 2) (Family: none)		
	/ ( )		
	16 May, 1995 (16. 05. 95), (Claims ; Fig. 2) (Family: none)		
7 January, 1997 (07. 01. 97)	JP, 9-1363, A (Hitachi,Ltd.), 7 January, 1997 (07. 01. 97), (Claims; Fig. 1) (Family: none)		
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
Special categories of cited documents;     "A" document defining the general state of the art which is not			
considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date	onsidered to be of particular relevance the principle or theory underlying the invention		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is considered novel or cannot be considered to involve an inventive step		
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	on date of another citation or other when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	exhibition or other considered to involve an inventive step when the document is		
means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	combined with one or more other such documents, such combination an being obvious to a person skilled in the art  "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 28 May, 1999 (28. 05. 99)  Date of mailing of the international search report 8 June, 1999 (08. 06. 99)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No.	Telephone No.		

	MARCHAN CIP J P 9	9/01089	
A. 発明の風する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. C1°. B23K26/06			
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl*. B23K26/00-26/06			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実用新案公報 1926-1999	·		
日本国公開実用新案公報 1971-1999			
日本国登録実用新案公報 1994-1999 日本国実用新案登録公報 1996-1999	•		
1年四天州初宋弘武公和 1990-1999			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	、 調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の		関連する	
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連する		請求の範囲の番号	
Y JP, 10-200269, A (/	ビデン株式会社)	1 - 4	
31.7月.1998 (31.07. Y JP,4-22190,U (日本電:	, 98/ (ノアミリーなし) 気レーザ機哭ェンジーアリッガ「	2	
株式会社) 24. 2月. 1992 (	24.02.92) (実用新案	2	
登録請求の範囲及び図2)(ファミ	リーなし)		
Y JP, 7-124778, A (株式: 16.5月.1995 (16.05.	会社ジャバンエナジー)	3	
図2) (ファミリーなし)	957(特計請求の範囲及び		
図2) (ファミリーなし) Y JP, 9-1363, A (株式会社	日立製作所)	4	
7. 1月. 1997 (07. 01.	97) (特許請求の範囲及び		
図1) (ファミリーなし)			
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー			
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公妻は	<b>られた</b> 文献であって	
60	て出願と矛盾するものではなく、	発明の原理又は理	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のために引用するもの		
以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、当	<b>省該文献のみで発明</b>	
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、当		
文献 (理由を付す)	上の文献との、当業者にとって自		
「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	5 <b>も</b> の	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 〇〇 〇〇 〇〇			
国際調査を完了した日 28.05.99 			
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	3P 9257	
日本国特許庁(ISA/JP) 加藤 昌人			
郵便番号100-8915			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3362	